

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges

Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum

3. Juli 2014 (03.07.2014)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

WO 2014/101989 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C30B 31/04 (2006.01) H01L 31/0216 (2014.01)

C23C 18/12 (2006.01) C09D 183/00 (2006.01)

C23C 18/32 (2006.01) H01L 21/22 (2006.01)

H01L 21/02 (2006.01) H01L 21/225 (2006.01)

H01L 21/48 (2006.01) H01L 31/0288 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2013/003838

(22) Internationales Anmeldedatum:

18. Dezember 2013 (18.12.2013)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

12008660.8 28. Dezember 2012 (28.12.2012) EP

13005734.2 10. Dezember 2013 (10.12.2013) EP

13005735.9 10. Dezember 2013 (10.12.2013) EP

13005736.7 10. Dezember 2013 (10.12.2013) EP

13005737.5 10. Dezember 2013 (10.12.2013) EP

(71) Anmelder: MERCK PATENT GMBH [DE/DE];  
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt (DE).

(72) Erfinder: KOEHLER, Ingo; Dilshoferstrasse 29, 64354  
Reinheim (DE). DOLL, Oliver; Nibelungenstrasse 113,  
63128 Dietzenbach (DE). BARTH, Sebastian;  
Verdrstrasse 2, 64291 Darmstadt (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,  
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,  
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,  
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,  
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,  
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,  
NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,  
RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH,  
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,  
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,  
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,  
TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,  
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,  
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,  
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,  
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,  
GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz  
3)

(54) Title: DOPING MEDIA FOR THE LOCAL DOPING OF SILICON WAFERS

(54) Bezeichnung : DOTIERMEDIEN ZUR LOKALEN DOTIERUNG VON SILIZIUMWAFERN

(57) Abstract: The invention relates to a novel method for producing printable, high-viscous oxide media and to the use thereof in  
the production of solar cells.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Verfahren zur Herstellung von druckbaren, hochviskosen  
Oxidmedien, und deren Verwendung in der Solarzellenherstellung



WO 2014/101989 A1